

大見研究室 和文 論文リスト

2001 年

- 960(M) 白井泰雪、永瀬正明、大見忠弘、「小規模生産ラインを具現化するガス供給システム」、クリーンテクノロジー、1月号、(日本工業出版)、pp2-5、2001年1月。
- 961(P) 大見忠弘、「シリコンアイランド九州活性化の条件」、全九州半導体技術フォーラム 2001年(第1回)、(熊本テクノポリス財団)、pp.6-1-6-3、2001年3月。
- 962(P) 大見忠弘、中山貴裕、譽田正宏、野澤俊之、藤林正典、望月健司、今井誠、小谷光司、「高品質・高圧縮率ベクトル量子化画像圧縮技術」、平成12年度特定領域研究 知的瞬時処理復号化集積システム(405)、pp.73-90、2001年3月。
- 963(P) 小谷光司、藩志斌、周偉銘、陳キュウ、李菲菲、大見忠弘、「ベクトル量子化コードブロック空間情報処理による顔画像・音声話者認識技術」、平成12年度特定領域研究 知的瞬時処理復号化集積システム(405)、pp.95-107、2001年3月。
- 964(M) 大見忠弘、「大学の新たな使命:新産業創出」、東北大学電通談話会記録、第69巻 第3号、(東北大学電気通信研究所)、p1、2001年5月。
- 965(P) 大見忠弘、須川成利、「平面集積から三次元集積へ」、第19回 BOC EDWARDS 半導体セミナー講演集、プロダクトイノベーション・・・半導体産業の新生、(大阪酸素工業㈱)、pp83-99、2001年6月。
- 966(M) 中尾慎一、中川宗克、大嶋一郎、島田浩行、大見忠弘、「高誘電率ゲート絶縁膜の低温形成に関する研究」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.101、No.108、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM2001-53、pp.1-6、2001年6月。
- 967(M) 大見忠弘、「新世紀の第2号刊行に寄せて 21世紀勝者の条件」、FUJIKIN Technical Annual Report ながれをこえて、(㈱フジキン)、pp.2-4、2001年6月。
- 968(P) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、「高画質大画面平板ディスプレイの新生産方式と検査技術」、FPDの更なる高精細化に対応する最新検査技術、専門技術セミナーテキスト(第11回フラットパネルディスプレイ製造技術展)、pp6-15、2001年7月。
- 969(B) 大見忠弘、「序文」、ウエットサイエンスが拓くプロダクトイノベーション、(サイペック㈱REALIZE事業部門)、pp I-III、2001年7月。
- 970(B) 大見忠弘、「序の章、半導体技術の発展、半導体表面の電子化学、表面電子化学の提唱」、ウエットサイエンスが拓くプロダクトイノベーション、(サイペック㈱REALIZE事業部門)、pp1-23、2001年7月。
- 971(B) 小島 泉里、大見忠弘、「室温レジスト剥離」、ウエットサイエンスが拓くプロダクトイノベーション、(サイペック㈱REALIZE事業部門)、pp105-116、2001年7月。
- 972(F) 阿久津功、平山昌樹、大見忠弘、「高効率半導体生産ラインを実現する高性能バックポンプの開発」、電子情報通信学会論文誌、Vol.J84-C No.8、(電子情報通信学会)、pp.690-696、2001年8月。
- 973(M) 大嶋一郎、島田浩行、中尾慎一、程イ涛、小野康弘、平山昌樹、須川成利、大見忠弘、「低温プロセスを特徴とする低抵抗 TaNx/Ta/TaNx ゲート電極・Si3N4 ゲート絶縁膜 MNSFET」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.101 No.249、(電子情報通信学会)、pp.71-76、2001年8月。
- 974(M) 石田雅裕、小谷光司、大見忠弘、「過渡電源電流試験法検証用テスト回路の試作」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.110、2001年8月。
- 975(M) 堺谷智、高橋和史、小谷光司、大見忠弘、「フレキシブルプロセッサ/演算増幅器 相乗りチップ」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.111、2001年8月。

- 976(M) 堺谷智、小谷光司、須川成利、大見忠弘、「フレキシブルプロセッサ(24×20 モジュール搭載版)」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育センター年報、(東京大学)、pp.128、2001 年 8 月。
- 977(M) 石田雅裕、小谷光司、大見忠弘、「配線間クロストーク測定用テスト回路の試作」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育センター年報、(東京大学)、pp.129、2001 年 8 月。
- 978(M) 高橋和史、小谷光司、大見忠弘、「パイプラインADC」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育センター年報、(東京大学)、pp.135、2001 年 8 月。
- 979(M) 堺谷智、小谷光司、須川成利、大見忠弘、「フレキシブルプロセッサ(24×20 モジュール搭載版)」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育センター年報、(東京大学)、pp.136、2001 年 8 月。
- 980(M) 石田雅裕、小谷光司、大見忠弘、「カップリングノイズ測定用テスト回路の試作」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育センター年報、(東京大学)、pp.136、2001 年 8 月。
- 981(P) 小谷光司、大見忠弘、「シリコンチップへの画像圧縮、顔認識の実装」、第 19 回日本ロボット学会学術講演概要集、(日本ロボット学会)、pp.98 IF26、2001 年 9 月。
- 982(P) 大見忠弘、「①Flash メモリ等超高性能化単結晶、多結晶シリコン表面のラジカルベース超高品質酸化、酸窒化、窒化膜形成技術」大見忠弘教授が提唱する「日本製造業の新たな挑戦」十分な価格競争力を有する超高性能半導体・ディスプレイ生産方式、(半導体産業新聞フォーラム)、pp.1-68、2001 年 10 月。
- 983(P) 大見忠弘、「③エンタテイメント用低消費電力化 高精細大画面デジタルディスプレイの構造と生産方式」大見忠弘教授が提唱する「日本製造業の新たな挑戦」十分な価格競争力を有する超高性能半導体・ディスプレイ生産方式、(半導体産業新聞フォーラム)、2001 年 10 月。
- 984(P) 大見忠弘、平山昌樹、阿久津功、白井泰雪、「半導体製造工程は、今何が問題なのか 総論 革命期を迎える半導体技術」、流体工学部門講演会講演概要集 No.01-3、(日本機械学会)、pp.309-312 F2-1、2001 年 10 月。
- 985(M) 林輝幸、鈴木要、斉藤美佐子、須川成利、大見忠弘、「真空装置内での有機物汚染挙動」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.101、No.350、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM2001-159~173、pp.23-27、2001 年 10 月。
- 986(M) 木暮雅彦、米原崇広、櫻井稔久、大見忠弘、「超純水中に残存する痕跡不純物のシリコンウエハへの付着挙動」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.101、No.350、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM2001-159~173、pp.29-33、2001 年 10 月。
- 987(M) 菅原広、田嶋義宣、大見忠弘、「電気透析法を用いた使用済み現像液の再生・再利用技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.101、No.350、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM2001-159~173、pp.39-44、2001 年 10 月。
- 988(M) 藪根辰弘、櫻井稔久、大見忠弘、「FPD用ガラス基板のエッチャントに関する研究」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.101、No.350、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM2001-159~173、pp.51-56、2001 年 10 月。
- 989(C) 中山貴裕、野澤俊之、藤林正典、望月健司、譽田正宏、小谷光司、須川成利、大見忠弘、「ベクトル量子化を用いた静止画像高画質高圧縮システム」、電子情報通信学会技術研究報告(デジタル信号処理研究会)、Vol.101、No.384、pp.47-52(論文番号DSP2001-116)、2001 年 10 月。
- 990(P) 大見忠弘、「大画面高精細・高機能・新TFT構造・製造プロセスの提案、新配線構造ディスプレイ」、液晶ディスプレイ・セミナー2001、E-4(1)、(日経BP社)、pp.1-1-1-16、2001 年 11 月。
- 991(M) 白井泰雪、大見忠弘、「半導体プロセスにおけるガス供給系・排気系のあるべき姿」、セミコンダクターマニュアル/ガス供給編 2001、(ガスメディア社)、pp.14-26、2001 年 11 月。
- 992(P) 木暮雅彦、米原崇広、櫻井稔久、大見忠弘、「半導体ウエットプロセスにおける超純水高性能化技術に関する研究」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.3-15、2001 年 11 月。

- 993(P) 菅原広、大見忠弘、「半導体薬液からのフッ素及び水回収技術」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.17-24、2001 年 11 月。
- 994(P) 藪根辰弘、櫻井稔久、大見忠弘、「FPD用ガラス基板のエッチングに関する研究」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.25-31、2001 年 11 月。
- 995(P) 林輝幸、鈴木要、斉藤美佐子、須川成利、大見忠弘、「減圧装置内での有機物汚染挙動及び酸化膜耐圧への影響」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.33-39、2001 年 11 月。
- 996(P) 上田直樹、山内祥光、斉藤祐司、平山昌樹、須川成利、大見忠弘、「微細素子分離上に形成するトンネル酸化膜の高信頼性化技術」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.49-56、2001 年 11 月。
- 997(P) 末永修、須川成利、大見忠弘、太田与洋、大村高弘、「半導体工場におけるエネルギー削減技術に関する研究＝真空断熱材の使用によるクリーンルーム空調設備負荷の低減＝」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.57-64、2001 年 11 月。
- 998(P) 大見忠弘、「新しいシリコン産業の創出」、第 12 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.93-103、2001 年 11 月。
- 999(P) 大見忠弘、「序文—新しいシリコン産業の創出」、第 36 回 UCT シンポジウム、(UCT フォーラム)、pp. I-III、2001 年 11 月。
- 1000(P) 大見忠弘、「新しいシリコン産業の創出」、第 36 回 UCT シンポジウム、(UCT フォーラム)、pp.1-10、2001 年 11 月。
- 1001(P) 大見忠弘、「新しいシリコン産業の創出」、第 11 回超高純度ガス供給系技術懇談会プロシーディング、(大阪酸素工業(株))、pp.5-31、2001 年 11 月。
- 1002(M) 小坂光二、高田真次、岩渕哲也、江頭義也、宮田昇、山川孝宏、渡邊雅行、森山司朗、荒尾淳、井上知行、高木宏司、大隈義信、井戸泰男、坂本博宣、永本恵市、原田崇、石橋秀隆、遠藤泰史、橋口弘幸、森園靖弘、中田明良、久保田弘、大見忠弘、(有)熊本テクノロジー、太平洋セメント(株)、(株)日本セラテック、(株)アラオ、オオクマ電子(株)、熊本県工業技術センター、熊本大学、東北大学、「超精密高速ステージ開発」、セミコン・ジャパン 2001 熊本フォーラム資料、((財)くまもとテクノ産業財団)、pp.13-20、2001 年 12 月。
- 1003(M) 吉岡和敏、竹下和弘、北野高広、小林真二、河田敦、宮川隆二、鏡裕行、中島大輔、森川晃次、中田明良、久保田弘、奥村勝弥、大見忠弘、東京エレクトロン九州(株)、日本ゼオン(株)、熊本県工業技術センター、くまもとテクノ産業財団、熊本大学工学部、熊本大学大学院自然科学研究科、東京大学先端科学技術研究センター、東北大学未来科学技術共同研究センター、「レジスト塗布工程におけるスキャン塗布・減圧乾燥技術の開発—その機構解明へ向けての研究」、セミコン・ジャパン 2001 熊本フォーラム資料、((財)くまもとテクノ産業財団)、pp.41-49、2001 年 12 月。
- 1004(M) 大見忠弘、「新しいシリコン産業の創出」、セミコン・ジャパン 2001 熊本フォーラム資料、((財)くまもとテクノ産業財団)、pp.73-76、2001 年 12 月。
- 1005(M) 大見忠弘、「HALCA プロジェクトの挑戦」、25TH SEMI Technology Symposium(STS) 2001、(SEMICON Japan)、pp.1-31、2001 年 12 月。
- 1006(F) 野澤俊之、藤林正典、中山貴裕、譽田正宏、小谷光司、須川成利、大見忠弘、「画像圧縮用ベクトル量子化プロセッサ」、計測と制御、((社)計測自動制御学会)、pp.897-901、2001 年 12 月。
- 1007(M) 大見忠弘、「ナノテクノロジーが拓く 21 世紀の社会～新半導体の夢を追って～量子力学、ナレッジ、ノウハウを総動員して半導体の最高峰を目指したい」、関西サイエンス・フォーラム第 32 号、((社)関西経済同友会内)、pp.5、2001 年 12 月。
- 1008(M) 大見忠弘、「大画面・高精細の新 TFT 構造、プロセスの提案—埋め込み配線構造や流し生産方式を導入」、フラットパネル・ディスプレイ、(日経 BP 社)、pp.184-191、2001 年 12 月。
- 1009(M) 大見忠弘、村川 順之、「グローバルネットワーク時代の半導体戦略」、個性の輝くコミュニケーション—21 世紀への夢—、(東北大学出版社)、pp.33-65、2001 年 12 月。